Образование нанодефектов в кристаллах LiF при гамма-облучении

© М.А. Муссаева, Э.М. Ибрагимова, М.У. Каланов, М.И. Муминов

Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана, 702132 Улугбек, Ташкент, Узбекистан E-mail: mmukhtar@yandex.ru, ibragimova@inp.uz

(Поступила в Редакцию 16 января 2006 г. В окончательной редакции 27 марта 2006 г.)

> Изучены спектры поглощения и фотолюминесценции, микротвердость, а также проведен рентгеноструктурный анализ кристаллов LiF, облученных гамма-излучением в остановленном реакторе и в источнике ⁶⁰Co с мощностью дозы гамма-излучения 7.65 Gy/s. Кроме образования точечных и комплексных радиационных дефектов в подрешетке Li обнаружены индуцированные гамма-облучением наночастицы фазы LiOH размером 28 nm. Показано, что образование дефектов происходит более эффективно в остановленном реакторе, чем в источнике ⁶⁰Co.

Работа выполнена по гранту ФПФИ АН РУ № 4-04.

PACS: 61.66.Fn, 61.80.Ed, 78.55.Fv

1. Введение

Гамма-излучение с широким спектром, сопровождающее нейтронный поток реактора, приводит к радиационному разогреву материалов. Поэтому оно обычно детектируется калориметром, загружаемым в активную зону реактора. В работе [1] решают проблему регистрации нейтронного излучения ²⁵²Cf, изучая кинетику затухания фотолюминесценции стекол, имеющих состав ⁶Li₂O-MgO-SiO₂-Се, обусловленную переходами $5d \rightarrow 4f$ в Ce³⁺. Сделано заключение, что на базе ⁶Li-силикатных стекол можно разработать и изготовить детектор нейтронов. Многими экспериментами показано, что гамма-излучение 60 Со с энергией $\sim 1.25 \,\mathrm{MeV}$ создает дефекты структуры в широкозонных диэлектрических материалах по неупругому механизму [2,3]. Поэтому высокоэнергетичное электромагнитное излучение реактора тоже вносит значительный вклад в ионизацию материалов наряду с потоками нейтронов с энергией выше 0.1 MeV и создает дефекты кристаллической структуры, а также изменяет электронную структуру. Однако энергетический спектр и поток гамма-квантов реактора не определен, хотя его вклад в образование дефектов при облучении материалов в реакторах смешанными потоками нейтронов и гамма-лучей имеет большое значение и для разработки радиационных технологий модификации структуры свойств твердых тел и для безопасной эксплуатации реакторов. Поэтому цель настоящей работы — исследование дефектов структуры, образованных в ионном диэлектрическом кристалле в результате воздействия гамма-излучения остановленного реактора с широким спектром энергий.

2. Экспериментальная часть

2.1. Объекты исследования. Были выбраны бесцветные и беспримесные диэлектрические кристаллы LiF с самой большой шириной запрещенной зоны 14 eV

и ионным типом химической связи, для которых оптические характеристики радиационно-наведенных центров окраски хорошо изучены [2-8]. Для LiF с малыми Z фотоэлектрический эффект слабый и превалирует механизм комптоновского рассеяния. Известно, что при ионизирующем облучении (Х- и гамма-лучи, а также электроны) в структуре LiF накапливаются стабильные и нестабильные центры электронного (F_n^-) и дырочного (V_n^-) типов (как одиночные, так и мультиплетные), образующиеся при агрегации первых [4]. Вакансия фтора, захватившая электрон, — хорошо известный стабильный F-центр, индуцированный по механизму радиолиза в LiF и ответственный за изолированную полосу поглощения при 250 nm, дивакансия — *М*-центр, обусловливающий полосу при 450 nm, тривакансия — полоса при 380 nm. В случае облучения ионами аргона с энергиями 5-30 eV до дозы $2 \cdot 10^{17}$ ion/cm² показано [5], что образуются стабильные F- и M-центры, причем распыление LiF происходит с нарушением стехиометрии в сторону увеличения концентрации катионной составляющей. Иными словами, происходит радиолиз приповерхностного слоя. В ЩГК совершенная дислокационная петля образуется в процессе заселения катион-анион дивакансии нейтральной молекулой галогена: $V_{\rm Li} + V_{\rm F} \rightarrow {\rm F}_2$ [2]. При исследованиях влияния быстрых и тепловых нейтронов на структуру монокристаллов LiF [6] было обнаружено, что при малых дозах $\sim 10^{17} \, {
m n/cm^2}$ точечные дефекты образуются беспорядочно, а при больших дозах они располагаются в виде упорядоченной дефектной структуры. В результате облучения потоками 1-9 MeV электронов тоже при дозе $10^{17}\,\mathrm{cm}^{-2}$ появляются скопления дефектов. В работе [7] в предварительно отожженых кристаллах LiF также обнаружены F-полоса поглощения при 250 nm и интенсивная термически устойчивая F2-полоса 450 nm и F2+полоса 645 nm при облучении дифференциальным потоком тепловых нейтронов $(2.5 \pm 0.3)10^{12}$ n/cm² · s до интегральной дозы 2.4 · 10¹⁴ n/cm². Следует отметить, что при такой ма-

2.2. Методы исследования. В настоящей работе использовались оптические и механические экспериментальные методы исследования радиационных повреждений в структуре облученных кристаллов LiF как в объеме, так и в приповерхностном слое, подвергаемом радиолитическому разложению. От большого монокристалла методом скалывания получали пластинки толщиной до 1 mm и площадью 1 cm². Пластинки LiF облучали после остановки реактора в вертикальном канале рядом с топливными сборками последовательно во времени от 3 до 146 часов. Спектры оптического поглощения измерялись на спектрометре Specord M-40 с поправкой на толщину каждого образца. Для большей надежности определения поглощения дозы по наведенным радиацией оптическим центрам использовался также метод фотолюминесценции (ФЛ) при возбуждении азотным лазером с длиной волны 337 nm. Кроме того, проводилось параллельно облучение образцов-свидетелей в каналах гамма-установки с известной энергией гамма-квантов 60 Co ~ 1.25 MeV и мощностью дозы 7.65 Gy/s несколькими дозами, при которых наводится примерно такое же количество оптических центров, как и при гаммаоблучении в остановленном реакторе. Концентрация оптических центров, ответственных за изолированную полосу поглощения или люминесценции, вычислялась по формуле Смакулы

$$N_F = 1.28 \cdot 10^{17} n / (n^2 + 2)^2 \cdot K_m H / f, \qquad (1)$$

где n — показатель преломления для длины волны, соответствующей максимуму F-полосы; f — сила осциллятора; H — полуширина F-полосы, eV; K_m — коэффициент поглощения в максимуме F-полосы, ст⁻¹.

Для определения глубины поврежденного радиолизом приповерхностного слоя кристалла проводились измерения микротвердости образцов до и после облучения на приборе ПМТ-3 по методу Викерса, учитывая то, что LiF — хрупкий оптический материал [9]. Нагрузка изменялась от 20 до 200 g при времени выдержки 10 s, чтобы получить заметный отпечаток пирамиды. Значения числа твердости H_{μ} (GPa) рассчитывались по формуле $H_{\mu} = 1.85 \cdot 10^4 P/d^2$, где P — нагрузка в граммах, а d^2 — диагональ отпечатка в микрометрах, и усреднялись по 15 измерениям. Глубина слоя l определялась при нагрузке, когда наблюдается резкое увеличение микротвердости до некоторого постоянного уровня, из соотношения

$$\frac{d}{2l} = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}, \quad \alpha = 136^{\circ}.$$
 (2)

Проверка надежности методики и результатов измерений микротвердости проводилась на эталонных образцах LiF и сравнивалась с известными характеристиками [9].

Параметры структуры, образование дефектов и примесных фаз исследовались методами широкоуглового и малоуглового рентгено-структурного анализа (PCA) на приборе ДРОН-3М.

В работе [10] были использованы различные рентгеновские методики для исследования образования большеугловых и малоугловых разориентаций в кристаллах LiF, деформированных растяжением в режиме ползучести, а также зависимости величины этих разориентаций от деформации, напряжения и температуры.

3. Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены спектры поглощения (слева) и фотолюминесценции (справа) кристаллов LiF до и после 54 часов облучения в γ -источнике ⁶⁰Со при 7.65 Gy/s $(доза 1.5 \cdot 10^7 \text{ R})$ и в выключенном реакторе в воде. При таких больших дозах облучения гамма-лучами полосы поглощения при 380 и 450 nm насыщаются, и появляются новые полосы 700 и 800 nm, а также появляется полоса ФЛ при 650 nm. При этих дозах происходит коагуляция одиночных вакансий фтора, и появляются полосы поглощения при 450 (F_2 -центры), 620 (F_2^+ -центры), 380 $(F_3$ -центры), 520 $(F_3^-$ -центры) и 800 nm $(F_3^+$ -центры). Таким образом, полученные спектры поглощения и люминесценции LiF, гамма-облученного в источнике ⁶⁰Со и в остановленном реакторе, согласуются с результатами, полученными при облучении на реакторе смешанным потоком нейтронов и гамма-излучения, или электронами [4-8]. Иными словами, вклад гамма-излучения преобладает над вкладом потоков нейтронов.

Оценка интенсивности гамма-излучения остановленного реактора по отношению интенсивностей полос ФЛ при 650 nm, наведенных в реакторе и источнике 60 Со (рис. 1, *b*), дает значение 35 Gy/s. Расчет концентрации F_2^+ -центров по формуле Смакулы (1) дает значение 4.3 · 10¹⁵ cm⁻³.

На рис. 2 показаны зависимости микротвердости H_{μ} образцов от массы нагрузки до и после гамма-облучения в источнике ⁶⁰Со и в остановленном реакторе. Видно, что после облучения H_{μ} растет во всем исследованном интервале нагрузок, что означает радиационно-индуцированное упрочнение приповерхностного слоя. Поскольку прирост величины микротвердости в результате 10 и 54 часов гамма-облучения в источнике ⁶⁰Со относительно облучения на реакторе сильно зависит от нагрузки, сравнение не позволяет оценить интенсивность гамма-потока в остановленном реакторе. Однако на некоторых участках кривых отношение величин H_{μ} для ⁶⁰Со и реактора дает значение 15 Gy/s, что гораздо ниже, чем оценка из оптических измерений. Причина



Рис. 1. Спектры поглощения (слева) и фотолюминесценции (справа) кристаллов LiF: *1* — эталон, *2* — *γ*-облучен в воде 54 h в ⁶⁰Со при 7.65 Gy/s, *3* — облучен 54 h в воде в остановленном реакторе.



Puc. 2. a — микротвердость LiF: 1 — эталон, $2 - \gamma$ -облучен 10 h в ⁶⁰Со при 7.65 Gy/s, 3 — облучен после остановки реактора 10 h. b — микротвердость LiF: 1 — эталон, $2 - \gamma$ -облучен 54 h в ⁶⁰Со при 7.65 Gy/s, 3 — облучен 54 h в остановленном реакторе.

такого расхождения в том, что оптические измерения основываются на объемных характеристиках, а микротвердость — на приповерхностном слое, структура которого изменяется в результате радиолиза. Причем это изменение неоднородно по глубине.

Для определения структуры и образования дефектов (радиолиз) и примесных фаз в приповерхностном слое использовались методы широкоуглового и малоуглового PCA. Кристаллы LiF имеют кубическую симметрию, образцы сколоты по плоскости (100). Фрагменты рентгенограмм показаны на рис. 3 для десятичасового гамма-облучения в воде в остановленном реакторе. Обнаружено изменение соотношения интенсивностей компонент и формы селективного рефлекса (200) в результате гамма-облучения (рис. 3), которое отличается от расчетного и свидетельствует о радиационноиндуцированном двойниковании структуры в плоскости {111} в матричной решетке LiF. Кроме того, происходит рост интенсивности диффузного и структурного рефлексов (112). Изменение формы диффузного пика и рост его интенсивности с ростом времени (поглощенной дозы) облучения происходит в результате радиолиза молекул воды на поверхности LiF и образования структурных дефектов самой решетки, а также допирования водоро-



Рис. 3. Фрагменты рентгенограмм кристаллов LiF: a, c, e — необлученный эталон и b, d, f — гамма-облученный 10 h в остановленном реакторе.

дом или OH-радикалами. Обнаруженный рефлекс (112) с межплоскостным расстоянием 1.612 Å принадлежит примесным щелочным нанопреципитатам LiOH, содержание которых увеличивается при гамма-облучении в воде, особенно в остановленном реакторе. Измерения микротвердости H_{μ} показали индуцированный облучением рост величины H_{μ} , что связано с образованием более плотной двойниковой структуры и нановключений фазы LiOH. Размеры этих включений, оцененные из рентгенограмм, составляют ~ 28 nm. При гамма-облучении LiF в воде в результате ее радиолиза в приповерхностном слое образуются водородосодержащие центры, ответственные за полосу поглощения при 280–300 nm, приписываемую X- или H-коллоидам [5–7]. Это согласуется с приведенными выше рентгенограммами, показывающими образование нанопреципитатов LiOH в результате коагуляции вакансий фтора и междоузельных атомов лития и радиолиза воды.

4. Заключение

В настоящей работе впервые использован метод выделения гамма-излучения после остановки реактора, т.е. после прекращения ядерной реакции, для проведения экспериментальных работ по воздействию гамма-излучения реактора с широким спектром энергий на процессы дефектообразования в широкозонном диэлектрическом кристалле LiF с ионным типом химической связи. Облучение различными дозами и сравнение с результатами для источника ⁶⁰Со позволило определить интенсивность гамма-излучения остановленного реактора около 35 Gy/s, что гораздо выше, чем для источника ⁶⁰Со. Проведены исследования воздействия гамма-потоков остановленного реактора на генерацию, накопление и коагуляцию точечных дефектов в анионной подрешетке. Обнаружены наведенные оптические центры в кристаллах LiF: одиночные вакансии фтора F (245 nm), дивакансии фтора с разным зарядом: F_2 (450 nm), F_2^+ (600 nm, люминесценция 650 nm), F_2^- (950 nm), а также тривакансии: F₃ (380 nm), F₃⁻ (520 nm), F_{3}^{+} (800 nm). Обнаружены радиационно-индуцированные изменения микротвердости приповерхностного слоя, а также образование кристаллической двойниковой структуры и нановключений примесной фазы LiOH в результате гамма-облучения в воде.

Список литературы

- Б.В. Шульгин, В.Л. Петров, В.А. Пустоваров, В.И. Арбузов, Д.В. Райков, К.В. Ивановских, А.В. Ищенко. ФТТ 47, 1364 (2005).
- [2] A.M. Stoneham. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A **91**, 1 (1994).
- [3] Frank W. Clinard, jr., Linn W. Hobbs. Physics of Radiation Effects in Crystals / Eds R.A. Johnson, A.N. Orlov. Elsevier Science Publishers B.V. (1986). P. 387.
- [4] Л.А. Лисицына, Т.В. Гречкина, В.И. Корепанов, В.М. Лисицын. ФТТ 43, 1613 (2001).
- [5] М.М. Меламед, В.Н. Опекунов, Н.К. Скокова, А.А. Предводителев. Радиационные эффекты в твердых телах. Наукова думка, Киев (1977). С. 150.
- [6] Е.В. Колонцова, И.В. Телегина, В.Л. Зефирова. Радиационные эффекты в твердых телах. Наукова думка. Киев (1977). С. 102–110, 158–165.
- [7] М.Г. Абрамишвили, З.Г. Ахвледиани, Т.Л. Калабегишвили, В.Г. Квачадзе, З.К. Саралидзе. ФТТ 40, 2044 (1998).
- [8] Б.В. Будылин, А.А. Воробьев. Действие излучений на ионные структуры. Государственное издательство литературы в области атомной науки и техники, М. (1962). 166 с.
- [9] С.Н. Державин, А.В. Иванов, С.С. Касымова, Е.М. Милюков. Микротвердость хрупких оптических материалов. Фан, Ташкент, (1983). 155 с.
- [10] Б.И. Смирнов, Р.С. Чуднова, В.В. Шпейзман. ФТТ 47, 1799 (2005).